Vol.36 No.8 August 2 0 0 0

833-8

Ti-B₄C 反应路径分析

唐建新 (北京航空材料研究院、北京 100095)

苗<u>标准</u>, 曾照强 (清华大学材料科学与工程系, 北京 100084)

12

TQ174.758

摘 要 通过熱力学计算、结合 Ti-B-C 的等温截面图分别获得了 Ti, B 和 C 在 1600 ℃的化学势稳定图、在满足热力学和 质量守恒条件下利用化学势从高向低扩散的原理、预测了在 1600 ℃等温等压时 Ti 和 B₄C 之间发生化学反应时可能存在的反应 路径、利用扩散偶实验证实了该温度条件下的反应扩散路径为: Ti/TiC₂/TiB/TiB₂/B₄C.

关键词 扩散.反应路径. Ti, B4C / 卡大马飞动器 长人一环花化2441 中图法分类号 TB39, TQ174.758.2 文献标识码 A 文章编号 0412-1961(2000)08-0833-04

ANALYSIS OF REACTION PATH BETWEEN Ti AND B₄C

TANG Jianxin Institute of Aeronautical Materials, Beijing 100095 MIAO Hezhuo, ZENG Zhaoqiang Department of Materials Science and Engineering, Tsinghua University. Beijing 100084 Correspondent: TANG Jianxin, Tel: (010)62566622-5154, E-mail: jianxin.tang@biam.ac.cn Manuscript received 1999-11-29, in revised form 2000-02-23

ABSTRACT The stability diagram of chemical potential for Ti-B-C system at 1600 °C was calculated using a thermodynamic method through Ti-B-C isothermal phase diagram. The possible reaction path between Ti and B₄C at 1600 °C has been given by using the stability diagram and thermodynamic and mass-balance condition. The reaction diffusion path demonstrated by the diffusion couple is : Ti/TiC_x/TiB/TiB₂/B₄C.

KEY WORDS diffusion, reaction path, Ti, B_4C

为获得高性能的高温结构陶瓷近年来发展了许多先 进的制造工艺.新型材料的成形与加工工艺相继出现,对 发展高新技术和改进传统产业结构提供了良好的物质基 础.一方面,新的烧结方法不断推广和应用、如热压烧结、气 压烧结以及热等静压烧结、基本解决了陶瓷材料的致密化 问题;另一方面、制粉工艺不断改进,出现的自蔓延高温合 成技术 (SHS, self-propagating high-temperature synthesis),将制粉工艺和烧结工艺同时进行成为陶瓷材料的 新的研究热点. Barsoum 等人 ^[1,2]用 Ti 粉和 B₄C 为原 料通过过渡塑性相工艺 (TPPP, transient plastic phase processing)制备出了 TiB₂-TiC 陶瓷基复合材料. TiC 和 TiB₂ 具有高导电性、高耐磨性、高硬度以及高的红硬 性、其中 TiB₂ 的导电性甚至高于金属 Ti, 且具有好的抵 抗塑性变形的能力, TiC 在高温条件下可以发生塑性变 形, 这表明 TiB₂-TiC 陶瓷基复合材料是一种具有发展前 途的高温结构陶瓷材料. 从相图上看、TiB₂和 TiC 的结 合热力学上一直到 2500 C 都是稳定的. 有研究表明, 在室 温条件下 TiB₂-TiC 复合材料的硬度 (HV) 为 23 GPa, 此值低于纯 TiC 的 27.5 GPa 和 TiB₂ 的 28.5 GPa, 然 而在 600 C时, 复合材料硬度为 8.3 GPa, 远超过 TiC 和 TiB₂ 的硬度、比起块体材料, 切削钢和研磨时磨损明 显减少 ^[3].

在此基础上, Tang 等人 [4.5] 用 TiH₂ 替代 Ti, 克 服了 Ti 粉的表面氧化, 在简化工艺的同时获得了更高性 能的 TiB₂-TiC 复合材料. 很显然, 在烧结过程中 Ti 与 B₄C 发生了化学反应. 对二元系统来说, 可以利用相图来 预测生成相, 如 Ti-B 体系. 1600 C 时 Ti 与 B 相互 接触将生成 TiB₂ 和 TiB, 而 Ti 与 TiB₂ 的接触将出现 TiB. 对于三元和多元的系统, 固态反应过程尚不清楚. Ti 与 B₄C 的反应路径,反应速率和最终的显微形貌将取 决于热力学和动力学过程,由于三元体系的复杂性,使在 设计复合材料时更具灵活性,可以通过控制显微结构来获

^{*} 收到初稿日期: 1999-11-29, 收到修改稿日期: 2000-02-23 作者简介: 唐建新、男、 1968 年生、工程师、博士

得所需性能的材料.可能的方法包括反应烧结 (影响因素 有:原料的类型、几何因素和配比)和热处理环境 (影响 因素如氧、碳分压等).为了合理地控制这些因素,首先必 须对三元体系的固态反应进行深入的研究.

本文利用相图结合热力学计算分别获得了 Ti_vB 和 C 在 1600 ℃的化学势,对 Ti 与 B₄C 可能存在的反应路径 进行理论分析、最后利用扩散偶实验确定了反应路径.

1 理论分析

1.1 化学势的计算

对于封闭系统、恒温、恒压的条件下平衡条件为

$$\sum \mu_i \mathrm{d}n_i \le 0 \tag{1}$$

式中, μ_i 为 i 组元的化学势, n_i 为 i 组元的摩尔数.

很显然, 元素能够从一相扩散到另一相的动力是由于 该元素在不同的相中化学势是不同的, 元素将从化学势高 的相迁移到化学势低的相. 因此可以通过化学势的计算来 预测化学反应进行的过程. 在三元系含有 p 个相的体系 中、恒温、恒压的化学平衡条件是

$$\begin{cases} \mu_{\mathrm{Ti}}^{(1)} = \mu_{\mathrm{Ti}}^{(2)} = \dots = \mu_{\mathrm{Ti}}^{(p)} \\ \mu_{\mathrm{B}}^{(1)} = \mu_{\mathrm{B}}^{(2)} = \dots = \mu_{\mathrm{B}}^{(p)} \\ \mu_{\mathrm{C}}^{(1)} = \mu_{\mathrm{C}}^{(2)} = \dots = \mu_{\mathrm{C}}^{(p)} \end{cases}$$
(2)

式中 µ^P 为 p 相中 i 组元的化学势. 如果所有的相均为化 学计量比、各相的自由能可以用组元的化学势直接写出、 而不需象固溶体那样来考虑组元之间的相互作用. 因此有

$$\begin{cases}
G^{(1)} = x_{\mathrm{Ti}}^{(1)} \mu_{\mathrm{Ti}}^{(1)} + x_{\mathrm{B}}^{(1)} \mu_{\mathrm{B}}^{(1)} + x_{\mathrm{C}}^{(1)} \mu_{\mathrm{C}}^{(1)} \\
G^{(2)} = x_{\mathrm{Ti}}^{(2)} \mu_{\mathrm{Ti}}^{(2)} + x_{\mathrm{B}}^{(2)} \mu_{\mathrm{B}}^{(2)} + x_{\mathrm{C}}^{(2)} \mu_{\mathrm{C}}^{(2)} \\
& \cdots \\
G^{(p)} = x_{\mathrm{Ti}}^{(p)} \mu_{\mathrm{Ti}}^{(p)} + x_{\mathrm{B}}^{(p)} \mu_{\mathrm{B}}^{(p)} + x_{\mathrm{C}}^{(p)} \mu_{\mathrm{C}}^{(p)}
\end{cases}$$
(3)

式中 $G^{(i)}$ 为 i 相在某温度条件下的标准生成自由能: $x_j^{(*)}$ 为 i 相中 j 组元的摩尔分数、且满足

$$x_{\rm Ti}^{(i)} + x_{\rm B}^{(i)} + x_{\rm C}^{(i)} = 1$$
 (4)

对于三相区、由相律可知在恒温恒压条件下自由度为 0、因此组元的化学势为定值; 而对于双相区、自由度为 1,因此某一组元的化学势可以看作是另外两组元的函数、其数值在两个三相区之间变动。

图1 给出了 Ti-B-C 系统在 1600 で的等温截面图、 图中双相区已经标出. 在此温度条件 Ti₃B4 相是否存在目 前还有争议,本文作者曾试图在 1600 で通过 TiB+TiB₂ 来制备、但 Ti₃B4 未能成功、因此在 1600 で的等温截面 图中没有考虑 Ti₃B4 相.

对于 Ti-B-C 体系假设: (1) 1600 C 时单质元素的 自由能为 0, 即 $\mu_{T}^{T} = \mu_{C}^{C} = \mu_{B}^{B} = 0$; (2) 由于是固态反应, 所有的相以固态形式存在,而且满足化学计量比,化学键的作用大于原子之间的相互作用,因此忽略元素原子之间 的相互作用;(3)对碳化钛,不考虑其非化学计量比的特 点,仅以TiC来计算。



图 1 Ti-B-C 系统在 1600 C的等温截面示意图 [6]

Fig.1 Isothermal phase diagram for Ti-B-C at 1600 C ^[6] (triple phases section being:

- $\textcircled{1}: \quad \mathrm{Ti}B_2 + B_4 \mathrm{C} + \mathrm{B}, \quad \textcircled{2}: \quad \mathrm{C} + \mathrm{Ti}B_2 + B_4 \mathrm{C},$
- $\textcircled{3}: \quad \mathrm{TiC} + \mathrm{TiB}_2 + \mathrm{C}, \quad \textcircled{3}: \quad \mathrm{TiC} + \mathrm{TiB}_2 + \mathrm{TiB},$

③: Ti+TiC+TiB)

Ti-B-C 体系会发生的化学反应及反应自由能如表 1 所示,表中 1600 ℃时的 ΔG 值分别可以看作是 TiB, TiB₂,TiC 和 B₄C 在此温度条件下的自由能. T 为绝 对温度.

赛1 Ti-B-C 体系中发生的化学反应及反应自由能^[5]
 Table 1 Chemical reaction and free energy for the Ti-B-C system

Formula	Free energy ^[7]	ΔG at 1600 C	
	J-mol ⁻¹	J-mol ⁻¹	
(1) Ti+B→TiB	$-163200+5.9T\pm40000$	-192149.3	
(2) Ti+2B \rightarrow TiB ₂	$-284500 + 20.5T \pm 20000$	-246103.5	
(3) $Ti+C\rightarrow TiC$	$-184800 \!+\! 12.55T \!\pm\! 6000$	-161293.8	
(4) C+4B→B ₄ C	$-41500 + 5.56T \pm 10000$	-31086.1	

图 2-4 分别给出了 Ti, B 和 C 在 1600 で时的化学 势图、图中① -- ⑤与图 1 相对应、代表不同的三相区。

1.2 反应路径的预测

除了化学势的变化、对实际化学过程还必须考虑以下 两个条件: (1) 热力学条件、对于 Ti-B₄C、反应扩散偶 生成的相在相图中必须是相邻的; (2) 反应过程的质量守 恒. 表 2 给出了在满足以上条件下通过化学势变化预测的 Ti-B₄C 的反应路径. 实际的反应扩散路径将取决于动力 学过程、影响因素包括: 原料的类型、几何因素、配比和 热处理环境因素如氧、碳分压等.



图 2 Ti在 1600 C的化学势稳定图

Fig.2 Chemical potential stable graph of Ti at 1600 °C (the meaning of numbers ① -- ③ is the same those in Fig.1, the same below)



聞3 B在 1600 ℃的化学势稳定图 Fig.3 Chemical potential stable graph of B at 1600 ℃

2 实验方法

Ti 板和 B₄C 板按照图 5 所示装炉形成扩散偶,在 1600 ℃, 8 MPa 条件下保温 30 min 后,对反应层利用 XRD 由表及里逐步进行相分析,确定扩散路径。

3 实验结果与讨论

图 6 给出了 Ti-B₄C 扩散偶烧结后中间层的划分 示意图. 表面 0 表示烧结后原 Ti 片的最外层 (烧结后 B₄C 极易与 Ti 层分离). 表面 1 则是磨去最外层 (大约 0.1 mm) 后的表面. 表面 2,3 和 4 依次类推.

图 7 是 Ti-B₄C 扩散偶分别保温 30 min 后得到的 反应中间层的 XRD 结果. 由于不能很好的控制反应层的 厚度,因此所得到的 XRD 衍射峰论较杂乱,但仍有规律



图 4 C 在 1600 C的化学势稳定图 Fig.4 Chemical potential stable graph of C at 1600 C

表2 1600 ℃ Ti-B₄C 体系可能存在的扩散路径及分析 Table 2 The possible diffusion path for the Ti-B₄C system at 1600 ℃

Diffusion path	Up	per d	iffnsio n	Yes or
	of following		No	
	chemical potential			
	Ti	в	с	•
Ti/TiB/TiC/TiB ₂ /B ₄ C	No	No	No	Yes
${\rm Ti/TiB/TiB_2/C/B_4C}$	No	No	No	Yes
${ m Ti/TiC/TiB_2/B_4C}$	No	No	No	Yes
$\rm Ti/TiC/C/TiB_2/B_4C$	No	No	No	Yes
${ m Ti}/{ m TiC}/{ m TiB}/{ m TiB_2}/{ m B_4C}$	No	No	No	Yes
${\rm Ti/C/TiC/TiB_2/B_4C}$	Yes	No	No	No
${\rm Ti}/{\rm Ti}B_2/{\rm Ti}B/{\rm Ti}C/C/B_4C$	Yes	Yes	No	No





Fig.5 Schematic of a conple made by Ti and B_4C plates

L

B₄C
Surface 0
Surface 1
Surface 2
Surface 3
Surface 4
Ti

图 6 不同反应层的示意图 Fig.6 Schematic of different reaction layers



图 7 1600 ℃、保温 30 min 各反应层的 X 射线衍射图

Fig.7 XRD patterns of reaction layers 0—4 (see in Fig.6) in ${\rm Ti-B_4C\ diffusion\ couple\ soaking\ at\ 1600\ C\ for\ 30\ min}$

可循. 从 Ti 层到 B₄C 层之间, TiC 首先出现, 接着出 现了 TiB, 最后是 TiB₂ 相. 从表面 2 到表面 1, TiC 的 峰值逐渐减弱, TiB 的峰值逐渐增强、说明在这个范围 内 TiC 的含量首先增加、然后随着 TiB 的出现而逐渐减 少. 在与 B₄C 最紧邻的表面 0, 出现了 TiB₂.

根据以上反应扩散偶的研究结果. 尽管各个反应物层 相互重叠、仍可以很清楚地得出 1600 ℃保温的整个扩散 路径: Ti/TiC_x/TiB/TiB₂/B₄C,它同时满足化学势从 高向低扩散的条件、符合前面的理论分析. 延长保温时间、 各反应层之间没有太大的变化、只是 TiB₂ 层逐新增厚、 且长成长柱状^[5].

4 结论

(1)通过熱力学计算获得了 Ti, B 和 C 在 1600 と 等温等压条件下的化学势稳定图.

(2)利用热力学条件和质量守恒条件,预测了 Ti-B₄C的反应路径,并通过扩散偶实验确定了反应路径为: Ti/TiC_x/TiB/TiB₂/B₄C.

参考文献

- Ramberg J, Wolfe C, Williams W. J Am Ceram Soc, 1985; C68: 78
- [2] Barsoum M W, Houng B. J Am Ceram Soc, 1993; 76(6): 1445
- [3] Brodkin D, Barsoum M W, Zavaliagos A, Kalidinli S. Ceram Eng Sci Pro, 1994; 15(4): 121
- [4] Tang J X, Zuo K F, Hu X Q. J Tsinghua Univ (Sci Tech), 1998; 38(12): 73

(唐建新, 左开芬、胡晓清, 清华大学学报、 1998, 38(12): 73)
 [5] Tang J X. Ph D Thesis, Tsinghua University, 1999: 72

- (唐建新.清华大学博士学位论文、 1999: 72)
- [6] Broodkin D, Barsoum M W. J Am Ceram Soc, 1996; 79(3): 785
- [7] Liang Y J, Che Y C. Handbook of Inorganic Thermodynamic Data. Shenyang: Dongbei University Press, 1993: 328

(梁英教,车荫昌,无机物热力学数据手册, 沈阳: 东北大学出版社, 1993: 328)